

Ultra-100清洁和单分子层成膜机集成了清洁和单分子层气态成膜功能于一体，可以用于纳米压印模具和基板提供单分子层分辨能力的成膜和清洁任务，也可以广泛用于其他需要真空，紫外，加热，成膜的各种应用，诸如光刻模具的清洁和成膜处理等。Ultra-100集成了真空，紫外O-Zone清洁，紫外聚合，单分子层气态成膜等能力于一体，可以选择单一或多元化学气体，只要按一个操作按钮，Ultra-100就可以全自动运作。Ultra-100的桌面设计非常简洁，性能优秀可靠稳定。

主要特点

集成真空，紫外，加热，单分子层成膜多功能于一体

集成清洁和单分子层成膜于一键操作

杰出的膜覆盖能力及均匀性
优异的清洁能力

适合各种大小的基板和模板

- 1", 2", 3", 4", 6" or 8"
- 各种尺寸及不规则形状模板与基板均可

全自动化程序控制操作

可接多种化学气体

单分子层气体成膜高分辨率

快速工艺循环时间

极高的用户灵活性

紧凑台式设计

性价比最优

基于超过12年、15代产品开发经验的自动化操作

Nanonex系统经过大量实时实地验证，质量可靠，性能优越稳定



Ultra-100 多功能集成清洁和单分子层气态镀膜系统

系统参数

尺寸

- 样品尺寸：上限是8"x8"
- 腔体尺寸：10"x10"x5.75"
- 全部机器尺寸：27"x21"x8.75"

典型基板

- 硅和氧化硅
- 砷化镓 (GaAs)
- 磷化铟 (InP)
- 玻璃，石英，熔石英
- 金属
- 陶瓷材料

气体，紫外Ozone和加热

- 真空：< 100 mTorr
- 最多4个气体接口可用于单分子气体镀膜
- 2"直径排气管
- 紫外灯波长：185纳米，254纳米，365纳米，436纳米
- 紫外光功率：250瓦
- 紫外光强度：> 10mW/cm2 (254nm波长)
- 基板加热能力：700瓦，最大温度175摄氏度

其他参数

纳米压印模板防粘处理
表面粘合度增加处理
全方位紫外Ozone清洁处理
去光刻胶处理
去残留膜处理
MEMS, NEMS抗粘连镀膜处理
微米，纳米流道表面处理
真空紫外聚合处理
特殊环境气体下的紫外光聚合处理